

[设为首页](#) | [加入收藏](#) | [管理登录](#) [搜索新闻](#) [搜索](#)

2018年10月4日 星期四

[学院首页](#) [学院介绍](#) [新闻公告](#) [科学研究](#) [本科生教学](#) [研究生教学](#) [党建工作](#) [常用下载](#) [办公指南](#)**师资队伍****袁凯**[全部](#)[教授](#)[研究员](#)[副教授](#)[副研究员](#)[高级工程师](#)[高级实验师](#)[实验师](#)[讲师](#)[助教](#)[助理实验师](#)[助理研究员](#)**团队介绍**[低维光电材料与真空器件](#)[信息显示与光电技术](#)[光电子器件与应用技术](#)[光电视觉信息处理与微波技](#)[术](#)[红外探测与传感技术团队](#)**个人简历**

1982年7月毕业于天津市南开大学物理系，2001年结业于吉林大学在职研究生班。
1982年于沈阳某微电子研究所参加工作：
1982年~1985年，任离子注入工艺技术员
1985年~1993年，负责蒸发、溅射工艺技术负责。
1991年~1994年，从事器件工程师工作，先后承担过若干种NMOS、CMOS电路的研制工作，负责器件的工艺设计、工艺连线及工艺调整。
1995年~1999年任研究所芯片研制中心工艺线长，负责工艺线所有器件（包括NMOS、CMOS、TTL器件）的工艺设计，工艺实施、工艺调整及生产管理。高级工程师
1999年~2001年，任研究所芯片研制中心副主任。研究员
2001年~2006年任研究所芯片研制中心主任。
2006年任总工程师。
2006年任电子科技大学光电信息学院研究员。

研究方向

十几年来，先后承接国家及部下达的科研任务有几十项，开展的基础工艺研究项目有：
肖特基TTL电路多层电极技术研究；
难熔金属及硅化物技术研究；
高温淀薄膜电阻技术研究；
VLSI高性能LDDMOSFET工艺研究；
特种内存多层多晶结构的生成、及腐蚀工艺研究；
特种内存优质薄层栅氧化特性研究；
抗辐射工艺技术研究；
红外焦平面双阈值、双层多晶工艺技术研究；
现从事研究方向：
MEMS工艺技术研究；
光电集成器件技术研究等。

获奖情况

共获部省科技进步一等奖一次，科技进步二等奖七次，科技进步三等奖三次。

主要论著

《Bi-CMOS工艺的高精度单向模拟开关研究》
(《微处理器》)等十多篇论文。